

а 2016 0050

Изобретение относится к области полимерных наноматериалов и фоточувствительных структур на их основе, которые могут быть использованы в оптоэлектронике для создания фотогальванических устройств и электрофотографических носителей информации.

Фоточувствительный слой на основе карбазольных сополимеров содержит сополимер N-винилкарбазола с 1-октенем сенсibilизированный 15% мас. 2,4,7-тринитрофлуоренона и 10...50% мас. Фтало-цианина меди, толщина фоточувствительного слоя составляет 1...10 мкм.

П. формулы: 1

Фиг.: 2